UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

INDRA

MICROELECTRÓNICA μe-UPM

Técnicas de litografía en Semiconductores

Microcredencial 6 ECTS (30h aula + 30h en SALA BLANCA)

CÁTEDRA UPM – INDRA en MICROELECTRÓNICA

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Introducción a la litografía
   i. Tipos de litografía
   ii. Tipos de Resinas
   iii. Ataques y gases específicos para los mismos
2. Litografía óptica
3. Litografía por haz de electrones (e-beam lithography, EBL)
4. Preparación de máscaras para litografía óptica
5. NanoFrazor Lithography (NFL)
6. Software de diseño de máscaras.
7. Software de cálculo de dosis basado en simulaciones Montecarlo y diseño de campos de escritura: BEAMER y TRACER

El 60% de las clases se realizarán en Sala Blanca

MATRÍCULA 100% GRATUITA, FINANCIADO POR CÁTEDRA UPM-INDRA

Del 16/02/2026 al 27/05/2026 (L y X de 17:00h a 20:00h)

PRESENCIAL. Aula 102L1 de la ETSIT y Sala blanca ISOM-IUPM

comunidad.microelectronica@upm.es

PREINSCRÍBETE

Financiado por la Unión Europea

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

España | digital 2026

PERTE Chip

CARACTERÍSTICAS PARA LA ADMISIÓN:

- **Será valorado positivamente haber superado la microcrecencial "Uso básico de Sala Limpia y preparación de muestras" a la hora de admitir a los alumnos. Si no es así, se tendrá en cuenta alguna experiencia previa en Sala Blanca.**

- **El número máximo de alumnos admitidos será 10 para asegurar la calidad de la docencia en las sesiones prácticas (laboratorio).**

PREINSCRÍBETE

Financiado por la Unión Europea
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip